



Système de dépôt sous vide par pulvérisation sous faisceau d'ions (DIBS)

➤ Principales caractéristiques :

Deux canons : sources d'ions \varnothing 100 mm RF Nordiko™, sans filament utilisables en réactif

Porte cibles 4 positions et porte substrat tournant et chauffant \varnothing 150 mm, $T_{\max} = 700^{\circ}\text{C}$

Dépôt et gravure en incidence variable (0-90°)

- **Canon de pulvérisation :**

A grilles molybdène focalisées, énergie : < 1500 eV

Courant typique : 80 mA, gaz : Ar, Xe

- **Canon d'assistance :**

A grilles molybdène planes, énergie : < 1500 eV

Courant typique : 40 mA, gaz : Ar, Xe, N₂, O₂

- **Système de vide :**

Pompes cryogéniques, vide limite : 10^{-8} mbar, pression de travail : 10^{-4} mbar

- **Cibles disponibles (\varnothing 6") :**

Ag, Al, Au, B, C, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Si, Ti, W, Zr, et BN, InSn, ITO, NiTi, Si₃N₄, SiO₂, TiAl, TiN, Y₂O₃

➤ Applications typiques :

Co-dépôt, dépôt assisté, oxyde, nitrure, multicouche, agrégats, gravure, R&D

➤ Personne à contacter : Yoann ROBIN